

Research Paper

Investigation of Thermoelectric, Dynamical, Electron and Optical Properties of C₃N Monolayer Using First Principles Calculations ¹

Erfan Cholaki², Borhan Arghavani Nia^{3*}and
Mohammad Hossein Sahafi⁴

Received: 2023.07.11

Revised: 2023.09.21

Accepted: 2023.11.21

Abstract

In this paper, the thermo-electric, phonon, electronic, and optical properties of the C₃N monolayer have been investigated using the Wien2K computational code based on first principles calculations in the framework of the density functional theory. The study of electronic properties shows the behavior of non-magnetic semiconductors with an indirect gap with a value of 0.5 electron volts for this two-dimensional structure. Also, optical properties such as dielectric function, reflection, energy loss function, absorption coefficient, and optical conductivity are calculated. C₃N monolayer is optically anisotropic in z and x direction, which according to the refractive index diagram leads to birefringence, which is a key parameter for this compound's linear optical performance. The results provide a fundamental understanding of the design of composite structures used in nanodevices based on two-dimensional advanced materials. The linear response approach along the symmetric points calculates the phonon dispersion diagram. The results indicate the absence of negative modes in the phonon spectrum, indicating that the structure is dynamically stable. Investigating the thermoelectric properties of the C₃N monolayer using the semi-classical Boltzmann theory shows that this monolayer has a value coefficient (ZT) close to one at room temperature and temperatures lower than room temperature. As a result, it can be proposed as a candidate for thermoelectric applications.

Keywords: Density Functional Theory, Optical Properties, The C₃N Monolayer, Semiconductor.

¹ <https://doi.org/10.22051/ijap.2023.44371.1339>

² Ph. D. Student, Department of Physics, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran. Email: erfancholaki@gmail.com

³ Assistant Professor, Department of Physics, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran. (Corresponding Author). Email: b.arghavani@gmail.com

⁴ Ph. D. Student, Department of Physics, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran. Email: hosseinsahafi91@gmail.com



بررسی ویژگی‌های ترموالکتریکی دینامیکی، الکترونی و اپتیکی تک‌لایه C_3N با استفاده از محاسبات اصول اولیه^۱

عرفان چولکی^۲، برهان ارغوانی نیا^{۳*} و محمدحسین صحافی^۴

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

فصلنامه علمی فیزیک کاربردی ایران

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

دانشکده فیزیک، دانشگاه الزهرا

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۸/۰۳

سال چهاردهم، پیاپی ۳۶، بهار ۱۴۰۳

صفحه ۷ - ۲۴

چکیده:

در این مقاله با استفاده از محاسبات اصول اولیه در چارچوب نظریه‌ی تابعی چگالی بررسی ویژگی‌های ترموالکتریکی، فونونی، الکترونی و اپتیکی تک‌لایه C_3N توسط کد محاسباتی Wien2K پرداخته شده است. مطالعه‌ی ویژگی‌های الکترونی رفتار نیمه‌رسانایی غیر مغناطیسی با شکاف غیرمستقیم با مقدار $5/5$ الکترون ولت را برای این ساختار دو بعدی نشان می‌دهد. همچنین، ویژگی‌های نوری از جمله تابع دی‌الکتریک، بازتاب، تابع اتلاف انرژی، ضربی جذب و هدایت نوری محاسبه می‌شوند. ویژگی‌های اپتیکی نیز نشان دهنده‌ی تاهمسانگردی اپتیکی تک‌لایه C_3N برای دو راستای x و z است، که با توجه به نمودار ضربی شکست منجر به ایجاد ویژگی دوشکستگی در این ساختار می‌شود، که یک پارامتر کلیدی برای عملکرد نوری خطی این ترکیب است. نتایج یک درک اساسی از طراحی ساختارهای کامپوزیتی مورد استفاده در دستگاههای نانو بر اساس مواد پیشرفته دو بعدی ارائه می‌دهد. دیگرام پاشندگی فونونی با استفاده از رهیافت پاسخ خطی در انتداد نقاط پر تقارن محاسبه می‌گردد. نتایج نشان دهنده نبود مدهای منفی در طیف فونونی است که بیان می‌کند ساختار به صورت دینامیکی در تعادل قرار دارد. بررسی ویژگی‌های ترموالکتریکی تک‌لایه C_3N با استفاده نظریه نیمه‌کلامیکی بولتزمن نشان می‌دهد که این تک‌لایه در دمای اتاق و دماهای پایین‌تر از دمای اتاق دارای ضربی ارزشی (ZT) نزدیک به یک است. در نتیجه می‌تواند به عنوان گرینه‌ای برای کاربردهای ترموالکتریکی مطرح گردد.

واژگان کلیدی: نظریه تابعی چگالی، ویژگی‌های اپتیکی، تک‌لایه C_3N ، نیمه‌رسانایی.

^۱ <https://doi.org/10.22051/ijap.2023.44371.1339>

^۲ دانشجوی دکترا، گروه فیزیک، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
Email: erfancholaki@gmail.com

^۳ استادیار، گروه فیزیک، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. (نویسنده مسئول).
Email: b.arghavani@gmail.com

^۴ دانشجوی دکترا، گروه فیزیک، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
Email: hosseinsahafi91@gmail.com



۱. مقدمه

همان‌گونه که می‌دانیم اولین ماده‌ی دوبعدی، گرافن که یک تک لایه از گرافیت است در سال ۲۰۰۴ کشف شد. در ساختار گرافن پیوند شیمیایی بین اتم‌های کربن ویژگی کاملاً کووالانسی دارد. گرافن دارای ویژگی‌های منحصر به فرد الکترونیکی، نوری و مکانیکی می‌باشد. با این حال، به دلیل شکاف انرژی صفر کاربرد آن‌ها در دستگاه‌های الکترونیکی محدود است [۲-۱]. کربن به لحاظ تنوع در پیوندها، عنصری است که سال‌های متعدد مورد بررسی پژوهشگران قرار گرفته است. همان‌گونه که می‌دانیم، کربن به سه شکل الماس، گرافیت و فلورین به ترتیب با هیبریداسیون^۱ sp^1, sp^2, sp^3 مبتلور می‌شود. حضور ناخالصی روی یک لایه گرافن بر ویژگی‌های مغناطیسی و رسانندگی آن تاثیر می‌گذارد. ویژگی منحصر به فرد مواد دوبعدی و کاربردهای متنوع آن‌ها در دستگاه‌های نانوالکترونیک و الکترومکانیکی توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است [۳]. یکی از ویژگی‌های جالب توجه مواد دوبعدی این است که با اعمال تغییرات از جمله افزایش یا کاهش تعداد لایه‌ها، اعمال میدان الکتریکی، جذب اتم، و وارد کردن ناخالصی می‌توان ویژگی‌های آن‌ها را تغییر داد. در این زمینه گزارش‌هایی ارائه شده است [۴]. به ویژه، به تازگی پلی‌آنیلین دو بعدی به نام (C₃N) ساخته شده است که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است [۵-۶]. C₃N را می‌توان به عنوان یک مورد ویژه از N آلایده شده به گرافن مشاهده کرد، موادی که ابتدا با حالت جامد تک بلورهای هگزامین بنزن تری هیدرو کلرید در اثر حرارت ایجاد می‌شوند [۷]. اگرچه شباهت زیادی بین صفحات C₃N و گرافن وجود دارد، اما وجود اتم‌های نیتروژن سبب بروز تفاوت‌های برجسته در ویژگی‌های الکترونیکی آن می‌شود، این ساختار به دلیل ویژگی‌های خاص خود کاربرد زیادی در صنایع مختلف پیدا کرده است [۸-۹]. خو و همکاران [۱۰]، با انجام پژوهش کاربردی بر روی تک لایه C₃N نشان دادند که مواد آند دارای ظرفیت بالا (۳۸۳/۳ mAh g^{-۱}) و همچنین پایداری بالای در ولتاژ پایین (۱/۵ ولت) را دارند. به تازگی، بیندلینگ و همکارانش [۱۱]، مطالعاتی را با استفاده از محاسبات اصول اولیه روی تک لایه آلایده^۱ شده با اتم بور انجام دادند و نتایج آن نوید بخش کاهش اکسیژن آزاد فلز در واکنش با کاتالیزور می‌شود. در سال‌های کنونی، مواد دوبعدی مورد مطالعه بسیاری از پژوهشگران به دلیل پدیدار شدن ویژگی‌های جدید و استفاده آن‌ها در برنامه‌های کاربردی قرار گرفته‌اند [۱۲-۱۳] که مطالعات گستره‌های در خصوص ویژگی‌های ساختاری مواد دوبعدی آلایده شده با اتم‌های مختلف آن‌ها

^۱ Doped



گزارش شده است [۱۴-۱۶]. در سال ۲۰۱۹، زاهدی و همکاران [۱۷]، اثر دما بر ویژگی‌های مکانیکی نانوصفحات BC_3 را مورد مطالعه قرار داد و نتایج این کار با C_3N مقایسه شد و نشان داد که ویژگی‌های مکانیکی C_3N در شرایط پایداری بالاتر از BC_3 است. جیم و همکارانش [۱۸]، نتایج جدیدی را برای مواد لایه نازک گزارش کردند که می‌توان به عنوان گرینه‌ای امیدوار کننده برای کاربردهای مختلف از جمله اپتوالکترونیک، فوتولالیست‌ها، حسگرهای گازی و دیودهای ساطع کننده نور در نظر گرفت [۱۹-۲۰]. یکی از مهمترین اقدامات برای پژوهش در مورد مواد دوبعدی، بررسی ویژگی‌ها و گسترش دامنه کاربردهای این مواد به شمار می‌آید که نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که آلایش یکی از مهمترین استراتژی‌ها برای اصلاح ویژگی‌های فیزیکی و شیمیابی گرافن و تشکیل شبه گرافن‌های جدید در نظر گرفته می‌شود [۲۱-۲۲]. در این مقاله، ویژگی‌های ترموالکتریکی، الکترونیکی، فونونی و اپتیکی تک‌لایه C_3N مورد بررسی قرار گرفته است.

۲. روش محاسبات

محاسبات با استفاده از کد Wien2K بر پایه نظریه تابعی چگالی انجام شده است [۲۳-۲۴]. این روش با انتخاب کره‌های مافین تین اطراف هر یک از اتم‌ها، فضای درون هر یاخته را به دو ناحیه تقسیم می‌کند. تابعی چگالی، پتانسیل و توابع موج الکترون‌های ظرفیت در درون کره‌ها بر حسب هماهنگ‌های شبکه و در خارج از آن‌ها بر حسب امواج تختی که بردار موج آنها از تقارن‌های گروه فضایی پیروی می‌کنند، بسط داده می‌شوند. برای انجام محاسبات، بهینه کردن و تعیین پارامترهای اولیه ضروری است. توابع پایه در ناحیه بین جایگاهی با مقدار $R_{MT}K_{max}=8$ شعاع کوچک-ترین کره مافین تین و K_{max} بردار موج قطع برای بسط تابع موج بر حسب امواج تخت) و برای بسط پتانسیل از پارامتر بهینه $G_{max}=12$ استفاده شده است. چگالی‌های الکترونی و پتانسیل داخل کره‌های مافین تین بر حسب توابع هارمونیک با شعاع قطع $l_{max}=10$ و در ناحیه‌ی بین اتم‌ها با استفاده از بسط فوریه محاسبه می‌گردند. انرژی جداسازی حالت‌های مغزه از ظرفیت برابر با $Ry=6$ - انتخاب شده است.



۳. نتایج

۱.۳ ویژگی‌های ساختاری

ساختار اتمی تک لایه C_3N که یک شبکه‌ی شش ضلعی مسطح است در شکل (۱) نشان داده شده است. ثابت شبکه C_3N و طول پیوند $C-N$ و $C-C$ در جدول (۱) فهرست شده است. (شکل (۲)).
به منظور بررسی ویژگی‌های C_3N ، محاسبات ساختار الکترونی آن بهینه شده است (شکل (۲)). برای بررسی پایداری شیمیایی این ساختارها به محاسبه انرژی چسبندگی^۱ آن پرداخته که از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$E_{(c)} = -\frac{E_{tot}^{C_3N} - [N_C E_C^{single} + N_N E_N^{single}]}{N_C + N_N} \quad (1)$$

که در آن، E_{tot} انرژی کل محاسبه شده برای ساختار C_3N و E_N به ترتیب انرژی اتم کربن و نیتروژن، N_C و N_N تعداد اتم‌های کربن و نیتروژن را نشان می‌دهند. نتایج این محاسبه، همانطور که مشاهده می‌شود، $-43/90$ کیلوژول بر مول را نشان می‌دهد که دلیلی بر پایداری ترمودینامیکی این ساختار است.

جدول ۱ ویژگی‌های ساختاری محاسبه شده برای تک لایه C_3N

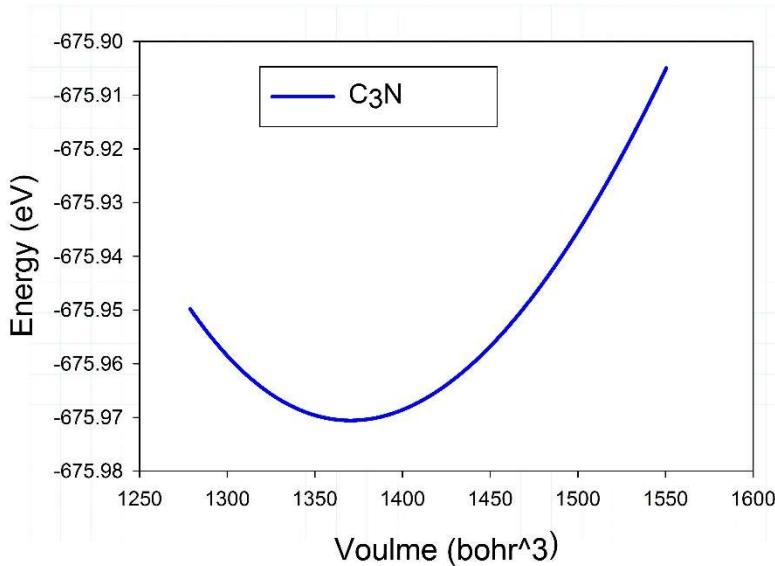
ساختار	ثابت شبکه (a.u.)	طول پیوند Å	PBE-GGA(eV)	کارهای نظری دیگران
C_3N	a=۹/۵۲ b=۱۹/۳۸	N-C ۱/۴۵۸ C-C ۱/۴۵۵	۰/۵	۰/۳۹ [۲۹-۲۶].



شکل ۱ سلول واحد اولیه C_3N .

^۱ Cohesive Energy

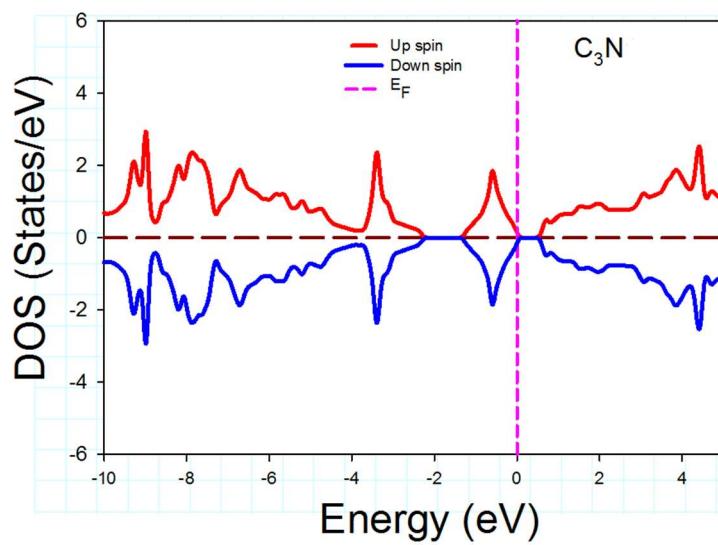




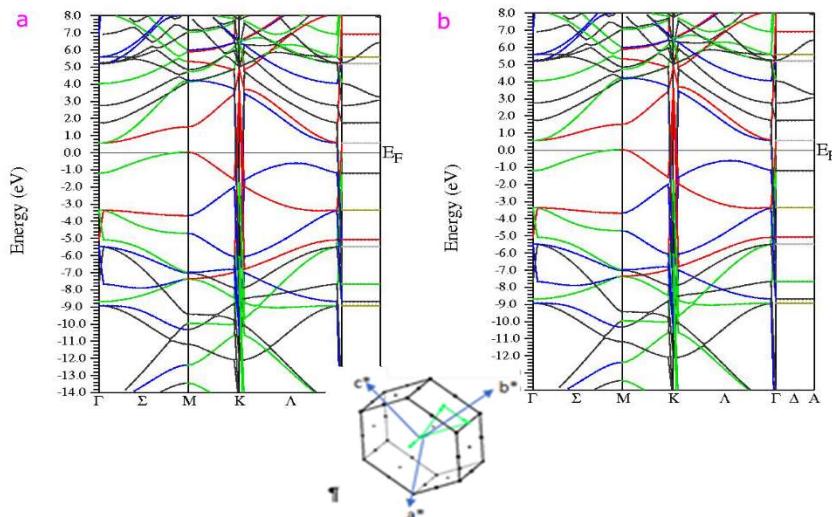
شکل ۲ نمودار تغییرات انرژی بر حسب حجم ساختار C_3N .

۲.۳ ویژگی‌های الکترونی

توزیع انرژی الکترون‌های نوار رسانش و ظرفیت از عوامل اساسی در تعیین ویژگی‌های الکترونی جامدات است. از آنجا که تعداد حالت‌های الکترونی در یک نوار الکترونی (رسانش یا ظرفیت) بسیار زیاد است، برای بیان تعداد این حالت‌ها از مفهوم چگالی حالت‌ها استفاده می‌شود [۲۵]. همچنین ساختار نواری می‌تواند داده‌هایی در مورد ماهیت بلور، فلز یا غیرفلز بودن، نبود یا وجود شکاف انرژی، اندازه و نوع شکاف انرژی، ارائه دهد. شکل (۳) چگالی حالت‌ها را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود، تک لایه C_3N یک نیمه‌رسانای غیرمغناطیسی با شکاف کوچک $0/5$ الکترون ولت است که با کارهای قبلی هماهنگی خوبی دارد [۲۶-۲۹]. نمودار ساختار نواری در شکل (۴) نشان داده شده است. با پارامترهای بهینه بدست آمده نوارهای انرژی با استفاده از تقریب PBE-GGA بدست آمد. نوارهای انرژی بدست آمده نشان می‌دهند که تک لایه C_3N خالص یک نیمه‌رسانای با شکاف غیرمستقیم و مقدار شکاف انرژی $0/5$ الکترون ولت در جهت $M \rightarrow \Gamma$ است. نتایج بدست آمده از ساختار نواری با نتایج چگالی حالت‌ها کاملاً هماهنگی دارد.



شکل ۳ نمودار چگالی حالتا C₃N برای اسپین بالا و پائین.



شکل ۴ تصویر a ساختار نواری C₃N برای حالت اسپین بالا و b برای حالت اسپین پائین.

۳.۳ ویژگی‌های اپتیکی

در بررسی ویژگی‌های اپتیکی یک جامد، رفتار ثابت‌های اپتیکی مختلف آن را بر حسب انرژی تابش، بررسی می‌کند. این ویژگی‌ها به صورت ثابت‌های ماکروسکوپی نظری تابع دی الکتریک^۱

^۱ Function Dielectric Constant



(۶) ضریب شکست $n(\omega)$ توصیف می‌شوند. ثابت دی الکتریک با ساختار بلوری و تقارن‌های موجود در بلور تغییر می‌کند. ثابت دی الکتریک کمیتی اسکالر نیست، بلکه تانسور است و مولفه‌های میدان جابه‌جایی \vec{D} و میدان الکتریکی \vec{E} را به هم ربط می‌دهد.

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad (2)$$

ارتباط بین ϵ و بردار موج k و فرکانس ω را می‌توان به شکل زیر بیان کرد.

$$k^2 = \frac{\epsilon(\omega)}{C^2} \omega^2 \quad (3)$$

اگر اثرات جذب موج توسط ماده در نظر گرفته شود، بردار موج \vec{k} یک مقدار مختلط خواهد داشت و در نتیجه $\epsilon(\omega)$ نیز یک تابع مختلط خواهد بود، که قسمت حقیقی و موهومی آن توسط رابطه‌ای موسوم به کرامرز-کرونیک به هم مرتبط می‌شوند. تابع کرامرز قسمت حقیقی تابع پاسخ نوری را با علم به قسمت موهومی، در تمام بسامدها و بالعکس تعیین می‌کند.

$$\epsilon(\omega) = \epsilon'(\omega) + i\epsilon''(\omega) \quad (4)$$

$$\operatorname{Re} \epsilon(\omega) = \epsilon'(\omega) = \epsilon_0 + \frac{2}{\pi} p \int_0^\infty \frac{\omega' \epsilon''(\omega) d\omega'}{\omega'^2 - \omega^2} \quad (5)$$

$$\operatorname{Im} \epsilon(\omega) = \epsilon''(\omega) = \frac{2\omega}{\pi} p \int_0^\infty \frac{[\epsilon'(\omega) - \epsilon_0]}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega' \quad (6)$$

در حالی که، p بر مقدار انتگرال کوشی دلالت دارد و باید مقدار اصلی انتگرال $\epsilon(\omega) \neq \epsilon'(\omega)$ با رابطه‌ی زیر بیان می‌شود.

$$\epsilon(\omega) = \epsilon'(\omega) + i\epsilon''(\omega) \quad (7)$$

که شامل قسمت‌های موهومی و حقیقی است و با ثابت‌های اپتیکی به هم مرتبط می‌شوند:

$$\begin{aligned} \epsilon'(\omega) &= n^2(\omega) - K^2(\omega) \\ \epsilon''(\omega) &= 2n(\omega)K(\omega) \end{aligned} \quad (8)$$

در تعریف ضریب شکست مختلط به صورت $N(\omega) = \sqrt{\epsilon(\omega)}$ داریم:

$$N(\omega) = n(\omega) + iK(\omega) \quad (9)$$

که با توجه به روابط بالا مشاهده می‌شود که قسمت حقیقی $N(\omega)$ همان ضریب شکست متعارف ماده یعنی $n(\omega)$ می‌باشد و قسمت موهومند آن $K(\omega)$ ضریب خاموشی نامیده می‌شود، که مستقیماً به جذب ماده مربوط می‌شود.

$$n(\omega) = \sqrt{\frac{|\varepsilon(\omega) + \operatorname{Re} \varepsilon(\omega)|}{2}} \quad (10)$$

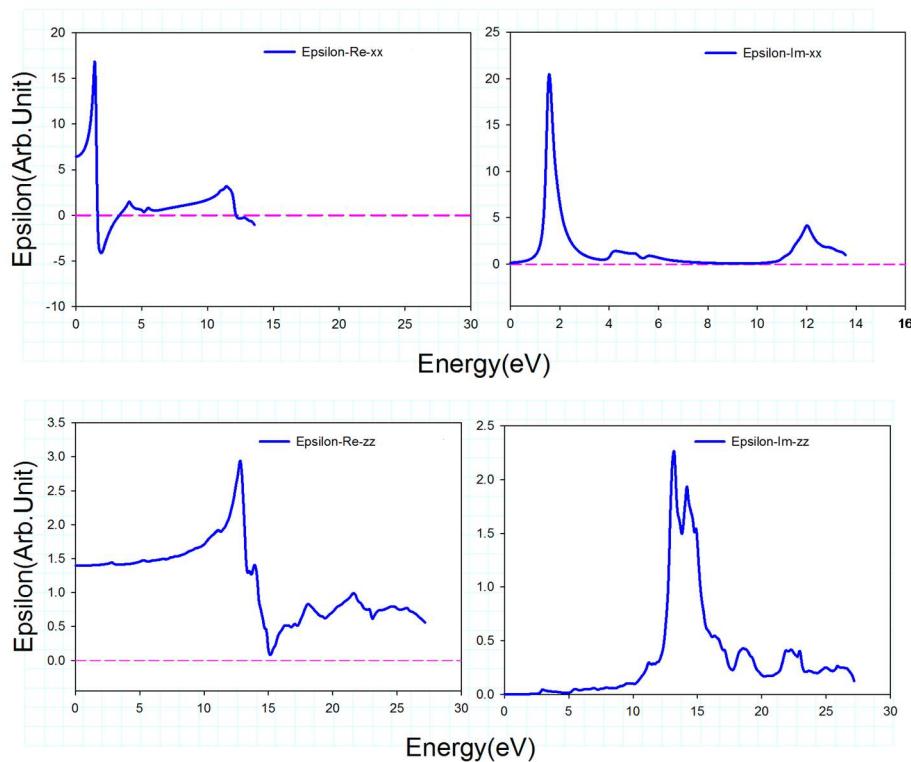
$$K(\omega) = \sqrt{\frac{|\varepsilon(\omega) - \operatorname{Re} \varepsilon(\omega)|}{2}} \quad (11)$$

کمیتی که در بررسی خواص اپتیکی اهمیت فراوانی دارد، ضریب جذب است که توسط رابطه زیر بیان می‌شود:

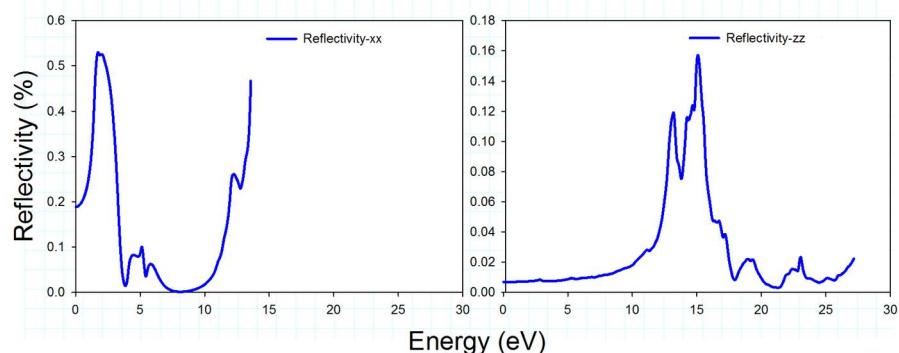
$$\alpha(\omega) = 2k(\omega) = \frac{\omega}{cn(\omega)} \varepsilon''(\omega) \quad (12)$$

ضریب جذب را می‌توان معیاری دانست از فاصله‌ی انتشار باریکه‌ی نور به داخل نمونه، تا قبل از اینکه شدت باریکه به $1/e$ مقدار اولیه خود نزول کند. از تansور دی‌الکتریک برای بررسی پاسخ بلور به میدان‌های الکترومغناطیسی برای راستاهای مختلف استفاده می‌شود. قسمت حقیقی و موهومند تابع دی‌الکتریک در شکل (۵) آمده است. ویژگی‌های اپتیکی نیز نشان‌دهنده ناهمسانگردی اپتیکی این ترکیب برای دو راستای X و Z است. به این معنا که رفتار بلور برای فوتون‌های ورودی در این جهت‌ها متفاوت خواهد بود. قسمت حقیقی تابع دی‌الکتریک در ناحیه انرژی $1/99$ و $13/49$ الکترون‌ولت برای حالت خالص دارای مقدار منفی می‌باشد که نشان بازتابندگی قوی در ماده است، اما در راستای Z هیچگونه بازتابندگی مشاهده نمی‌شود.





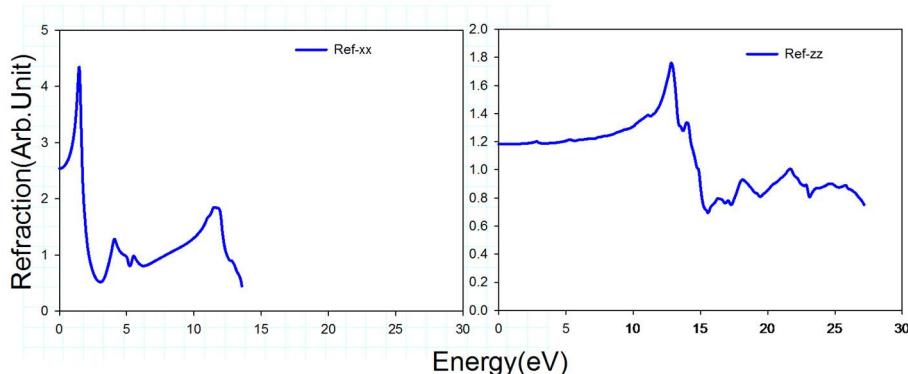
شکل ۵ تصویر بالا: قسمت حقیقی موهومی تابع دیالکتریک در راستای X و تصویر پایین: قسمت حقیقی و موهومی تابع دیالکتریک در راستای Z برای ساختار C_3N .



شکل ۶ نمودار بازتابندگی بر حسب انرژی در راستای X و Z برای ساختار C_3N .

شکل (۶) نمودار بازتابندگی بر حسب انرژی را نشان می‌دهد. در ناحیه‌های که انرژی که قسمت حقیقی تابع دیالکتریک منفی می‌باشد بازتابندگی بیشترین مقدار را نشان می‌دهد. همچنین، مشاهده

می شود در راستای X و Z ضریب انعکاسی تغییر می کند و این به دلیل ناهمسانگردی بلور می باشد. همچنین با توجه به شکل (۷) در این ناحیه ضریب شکست کمترین مقدار را نشان می دهد. از طرفی نواحی که در قسمت حقیقیتابع دی الکتریک در راستای X و Z بیشینه است، ضریب شکست نیز بیشترین مقدار خود را دارد. به صورت کلی، رفتار ضریب شکست و تابع دی الکتریک مشابه اند. تابع دی الکتریک استاتیک برای راستای X ۶/۴۱ برای حالت خالص است، همچنین برای راستای Z این مقدار ثابت و برابر ۰/۸۲ می باشد. برای C₃N ریشه در دامنه ۴/۲۴ - ۷/۴. الکترون ولت قرار دارد، جایی که ترکیب به نور فرودی پاسخ نمی دهد.

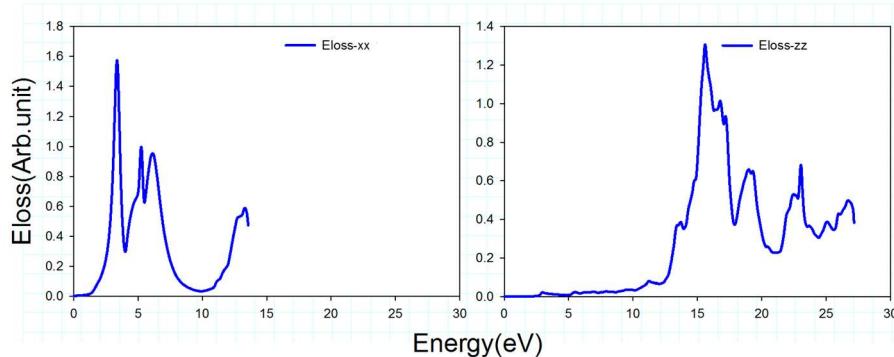


شکل ۷ نمودار شکست بر حسب انرژی در راستای X و Z برای ساختار C₃N.

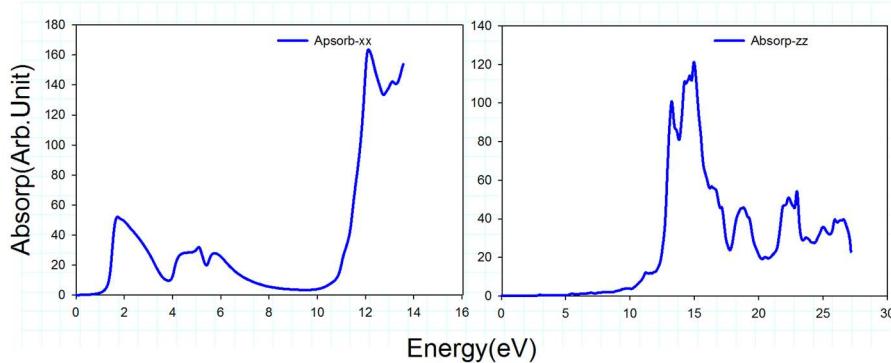
قله های تغییرات انرژی همراه با تحلیل صفرهای قسمت حقیقی نوسانات پلاسمونی را مشخص می کند که به صورت کلی قله های اتلاف بیانگر پلاسمون حجمی است. نمودار تغییرات قسمت موهومی تابع دی الکتریک بر حسب انرژی فوتون فرودی در شکل (۵) آمده است. در راستای X منحنی برای انرژی های کوچک تیز است. این تیزی به دلیل سهم جمله درود می باشد که مربوط به گذار درون نواری است و در انرژی های کمتر از ۱ الکترون ولت نمود پیدا می کند. در راستای X هیچ گونه جذبی مشاهده نمی شود. می توان چنین نتیجه گرفت که گذارهای الکترونی درون نواری، که سطح فرمی را قطع کرده اند، مربوط به الکترون های پیوند π (پای) می باشند. در راستای Z در محدود نور مرئی هیچ گونه جذبی برای بیان وجود ندارد. بیشته جذب در انرژی های بالاتر ۱۰ الکترون ولت مشاهده می شود که در شکل (۱۰) نشان داده شده است. تغییرات تابع اتلاف انرژی الکترون بر حسب انرژی فوتون ورودی برای راستای X و Z در شکل (۸) ارائه شده است. در حالت خالص در راستای X مشاهده می شود که در محدود ۰/۸۸ الکترون ولت اتلافی وجود ندارد. پس



می‌توان نتیجه گرفت پلاسمون‌های حجمی در این انرژی اتفاق نمی‌افتد. در راستای Z تا انرژی‌های پایین‌تر از ۱۰ الکترون‌ولت هیچگونه اتلاف مشاهده نمی‌شود و قله‌های تیز مشاهده شده مشابه قله‌های ترسیم شده در قسمت حقیقیتابع دیالکتریک می‌باشد.



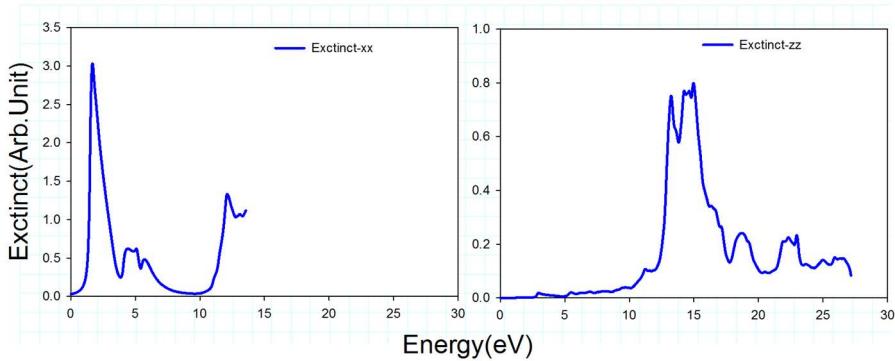
شکل ۸ نمودار اتلاف بر حسب انرژی در راستای X و Z برای ساختار C_3N .



شکل ۹ نمودار جذب بر حسب انرژی در راستای X و Z برای ساختار C_3N .

ضریب شکست و ضریب خاموشی به ترتیب در شکل‌های (۷) و (۱۰) نشان داده شده است. ضریب شکست یکی از کمیت‌های مهم در کاربردهای اپتیکی به شمار می‌آید. اغلب در تجهیزات نوری از موادی استفاده می‌کنند که ضریب شکست آن‌ها در دامنه وسیعی از انرژی ثابت باقی بماند و یا تغییر اندکی داشته باشند. زمانی که نمودار بیشینه‌های ضریب شکست در راستاهای مختلف تفاوت داشته باشد، نمایانگر ویژگی دوشکستی در این ساختار می‌شود. ضریب شکست استاتیکی برای حالت خالص در راستای X برابر با $2/61$ و در راستای Z این مقدار ثابت و برابر $1/21$ می‌باشد. ضریب خاموشی نشان دهنده جذب در محیط می‌باشد. نمودار ضریب خاموشی شباهت زیادی با نمودار بخش موهومی تابع دیالکتریک دارد که می‌توان در شکل (۱۰) مشاهده نمود. ضریب خاموشی

کم به این معنا است که موج الکترومغناطیسی به آسانی داخل ماده عبور می‌کند و ضریب خاموشی بزرگ نشان می‌دهد پرتو به سختی داخل ماده عبور می‌کند.



شکل ۱۰ نمودار ضریب خاموشی بر حسب انرژی در راستای X و Z برای ساختار C₃N.

۴.۳ ویژگی‌های فونونی

به منظور مطالعه‌ی دینامیک شبکه، ابتدا ساختار نواری فونونی در امتداد مسیرهای پرتقارن $\Gamma \rightarrow M \rightarrow K \rightarrow \Gamma$ در منطقه اول بریلوئن محاسبه می‌شود. طیف فونونی این ترکیب به صورت یک ابر سلول^۱ تحت شرایط تعادل در شکل (۱۱) نشان داده شده است. در روابط پاشندگی یک ماده، ۳P_۱ شاخه‌ی فونونی وجود دارد که P اتم‌ها در سلول واحد اولیه است. از این رو، سه شاخه متناظر با مدهای صوتی^۲ و ۳P_۱ شاخه به مدهای نوری^۳ تعلق دارد. در ابر سلول C₃N هشت اتم وجود دارد، از این رو، بیست و چهار شاخه‌ی فونونی در نمودار پاشندگی فونونی دیده می‌شود. سه شاخه‌ی صوتی شامل یک شاخه‌ی صوتی طولی (LA)، یک شاخه‌ی صوتی عرضی (TA) و یک شاخه‌ی صوتی (ZA) در راستای Z (به سمت خارج از صفحه yx) در ناحیه‌ی بسامدهای پایین وجود دارند. مدهای صوتی طولی نسبت به مدهای صوتی عرضی بسامد بالاتری را دارند. از طرف دیگر، بیست و یک شاخه نوری شامل هفت مدنوری طولی (LO) و چهارده مدنوری عرضی (TO)، در ناحیه‌ی بسامدهای بالا دیده می‌شوند. همان‌طور که در شکل (۱۱) نشان داده شده است، مدهای (TO) بسامد پایین‌تری را نسبت به مدهای (LO) دارند. همچنین، مدهای TO در مسیر $\Gamma \rightarrow M$ تبعگن هستند. تمام بسامدهای محاسبه شده در سراسر منطقه اول بریلوئن مثبت‌اند و هیچ بسامد موهمی مشاهده نشده است. بنابراین، بلور در تعادل دینامیکی قرار دارد. برای بررسی

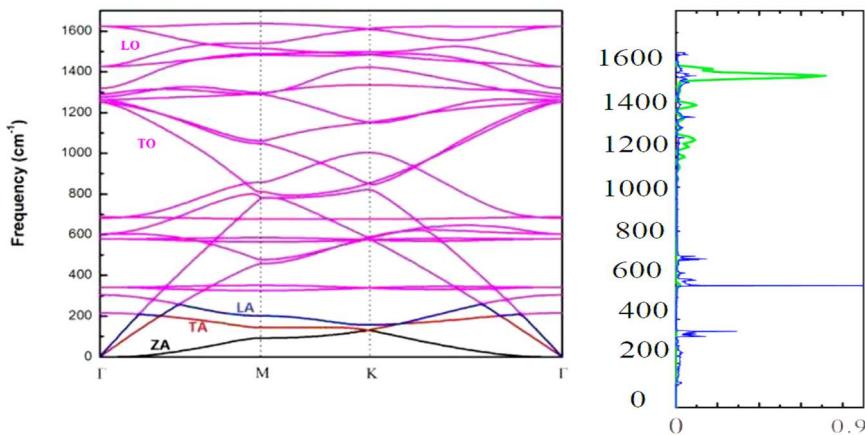
¹ Supercell

² Acoustic

³ Optical



بهتر نمودار پاشندگی فونونی به صورت جزئی، چگالی حالت‌های ارتعاشی در شکل (۱۱) ترسیم می‌شود. به دلیل متفاوت بودن جرم اتم‌های C و N چگالی حالت‌های فونونی دو ناحیه‌ی مجزا جداسازی می‌شود: سبک‌تر بودن اتم C دامنه‌ی جابه‌جایی بزرگتری را سبب می‌شود، در نتیجه بسامدهای نوری در محدوده $1100-1600\text{ cm}^{-1}$ بیشتر با استفاده از زیر شبکه‌ی C کنترل می‌شوند. در حالی که مدهای صوتی در منطقه بسامدهای پایین 700 cm^{-1} که ناشی از ارتعاشات اتم N می‌باشد، غالب هستند. همچنین، یک فاصله‌ی نواری در رنج $700-1100\text{ cm}^{-1}$ برای تک لایه وجود دارد. در این شکاف ممنوعه، امواج الکترومغناطیسی شدیداً تضعیف و نمی‌توانند در محیط منتشر شوند، بنابراین، کاملاً از سطح بازتاب می‌گردند.



شکل ۱۱ نمودار پاشندگی فونونی و چگالی حالت‌های ارتعاشی در دما و فشار صفر برای ساختار C_3N .

۵.۳ ویژگی‌های ترمولکتریکی

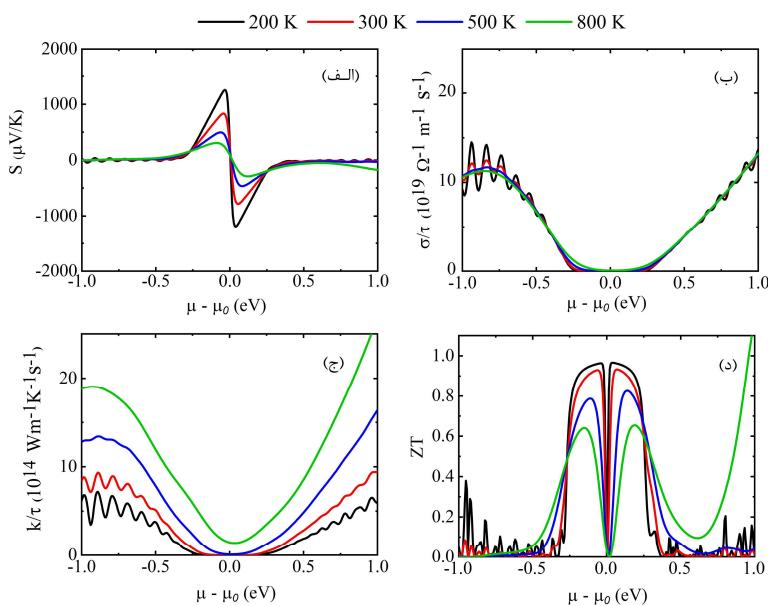
ویژگی‌های ترمولکتریکی تک لایه دو بعدی C_3N با استفاده از نظریه نیمه‌کلاسیکی بولتزمن با در نظر گرفتن تقریب زمان واهلش ثابت محاسبه شده است. از شرط‌های داشتن ماده ترمولکتریک بازده بالا می‌توان به دارا بودن ضریب سیبک و رسانندگی الکتریکی بالا و رسانندگی گرمایی پایین اشاره کرد. پارامترهای ترمولکتریکی تک لایه C_3N شامل ضریب سیبک، رسانندگی الکتریکی، رسانندگی گرمایی و ضریب ارزشی برای چهار دمای مختلف $200, 300, 500$ و 800 کلوین بر حسب تابعی از پتانسیل شیمیایی که در شکل (۱۲) نشان داده شده است. لازم به بیان است که در شکل (۱۲) انرژی فرمی به عنوان نقطه صفر انرژی در نظر گرفته شده است. تغییرات ضریب سیبک بر حسب پتانسیل شیمیایی در رنج $1-4$ دمای متفاوت در شکل (الف) به

نمایش درآمده است. همانطور که مشاهده می‌شود با افزایش دما، ضریب سیبک کاهش می‌باید و بیانگر این است که بازده ترمولکتریکی این ساختار در دماهای پایین بالاتر می‌باشد. ضریب سیبک در بازه تقریبی $-0.5/0.5$ الکترون‌ولت غیرصفر می‌باشد و به ازای پتانسیل‌های شیمیابی بالاتر به صفر میل می‌کند. بیشینه ضریب سیبک مربوط به دمای 200 K کلوین می‌باشد ($1257/25\mu\text{V/K}$) که دارای مقداری مثبت است. این امر بیانگر این است که حفره‌ها به عنوان حامل‌های بیشینه در طول نمونه از سمت گرم به سمت سرد حرکت می‌کنند. بیشینه ضریب سیبک برای دماهای 300 K و 500 K 800 K کلوین به ترتیب برابر با $833/8\text{ }\mu\text{V/K}$ و $497/9\text{ }\mu\text{V/K}$ است.

شکل (ب) رسانندگی الکتریکی تک لایه C_3N بر حسب تابعی از پتانسیل شیمیابی را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود رسانندگی الکتریکی وابستگی کمی به دما دارد و برای هر چهار دما دارای رفتاری مشابه می‌باشد. همچنین رسانندگی الکتریکی با افزایش پتانسیل شیمیابی افزایش می‌یابد. بیشتر بودن رسانندگی الکتریکی در قسمت پتانسیل‌های شیمیابی منفی بیانگر این است که حامل‌های نوع p نقش بیشتری در رسانندگی الکتریکی دارند. بر اساس شکل (ج)، رسانندگی گرمایی با افزایش دما و پتانسیل شیمیابی افزایش می‌یابد، به صورتی که بیشینه و کمینه رسانندگی گرمایی به ترتیب در دمای 700 K و 200 K بروز قرار گرفته است. از آنجایی که پایین بودن رسانندگی گرمایی شرطی برای داشتن ماده ترمولکتریک بازده بالاتر است، در نتیجه این تک لایه در دماهای پایین‌تر دارای عملکرد ترمولکتریکی بهتری می‌باشد.

شکل (د)، تغییرات ضریب ارزشی (ZT) برای چهار دمای مختلف را نشان می‌دهد. ZT با افزایش دما روندی کاهشی از خود نشان می‌دهد. بیشینه مقدار ZT در دمای 200 K کلوین به مقدار قابل توجه 0.96 می‌رسد. مقدار ZT در دمای 300 K کلوین به 0.93 می‌رسد و مقدار بیشینه این پارامتر برای دماهای بالاتر یعنی 500 K و 800 K به ترتیب به 0.82 و 0.64 می‌رسد. نتایج نشان می‌دهد که تک لایه C_3N نه تنها در دمای اتاق و زیر دمای اتاق بلکه در دماهای بالاتر نیز دارای بازده ترمولکتریکی قابل توجهی است.





شکل ۱۲ پارامترهای ترموالکتریکی تک لایه دو بعدی C_3N . (الف) ضریب سیبیک، (ب) رسانندگی الکتریکی، (ج) رسانندگی گرمایی، (د) ضریب ارزشی.

۴. نتیجه‌گیری

در این مقاله ویژگی‌های ساختارتک لایه C_3N با روش تابعی چگالی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده از محاسبات نشان می‌دهند تک لایه C_3N نیمرسانای غیرمغناطیسی با شکاف غیرمستقیم با مقدار $5/5$ الکترون‌ولت می‌باشد. بررسی نمودارهای تابع حقیقی و موهمی تابع دی‌الکتریک در راستای X و Z ناهمسانگردی این ساختار را نشان می‌دهد. تفاوت در نمودارهای ضریب شکست راستای X و Z منجر به بروز ویژگی دوشکستگی در این ساختار می‌گردد. بیشهه جذب در انرژی‌های بالاتر 10 الکtron‌ولت برای این ساختار در انرژی $4/13$ مشاهده می‌شود. طف فونونی در امتداد مسیرهای پرتقارن در منطقه‌ی اول بریلوئن به وسیله‌ی نظریه‌ی اختلالی تابعی چگالی محاسبه شدند. در نمودار پاشندگی فونونی، هیچ بسامد موهمی یافت نشد که نشان دهنده پایداری دینامیکی ساختار بلوری است. محاسبه پارامترهای ترموالکتریکی تک لایه C_3N نشان داد که اگر چه رسانندگی الکتریکی این تک لایه به دما وابسته نمی‌باشد، اما ضریب سیبیک با افزایش دما کاهش و رسانندگی گرمایی با افزایش دما افزایش می‌یابد. در نتیجه این تک لایه در دماهای پایین تر دارای بازده ترموالکتریکی بهتری است.

۵. تقدیر و تشکر

از استاد گروه فیزیک آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، خانم دکتر سحر رضایی و آقای دکتر سجاد پارسا مهر کمال تشکر و قدردانی را داریم.

منابع

- [1] Wu P., Du P., Zhang H., and Cai C., " Graphyne-supported single Fe atom catalysts for CO oxidation", *Physical Chemistry Chemical Physics*, **17(2)**, 1441-1449, 2014, <https://doi.org/10.1039/C4CP04181J>
- [2]. Machado B.F and Serp P., " Graphene-based materials for catalysis", *Catal. Sci. Technol*, **2**, 54-75, 2012, <https://doi.org/10.1039/C1CY00361E>
- [3] Castro Neto A.H., Guinea,F. Peres N.M.R., Novoselov K.S., and Geim A.K., " The electronic properties of graphene", *Rev. Mod. Phys*, **81(1)**, 109-162, 2009, <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.81.109>
- [4] Adamska L., and Sharifzadeh S., " Fine Tuning the Optoelectronic Properties of Freestanding Borophene by Strain", *ACS Omega*, **2**, 8290-8299, 2017, <https://doi.org/10.1021/acsomega.7b01232>
- [5] Yang S.W., Li W., Ye C.C., Wang G., Tian H., Zhu C., He P., Ding G.Q., Xie X.M., Liu Y., Lifshitz Y., Lee S., Kang Z., and Jiang M., "C₃N—A 2D crystalline, hole-free, tunable-narrow-bandgap semiconductor with ferromagnetic properties." *Advanced Materials*, **29**, 1605625, 2017, <https://doi.org/10.1002/adma.201605625>
- [6] Makaremi M.; Mortazavi B., and Singh C., "Adsorption of Metallic, Metalloidic, and Nonmetallic Adatoms on Two-Dimensional C₃N", *J. Phys. Chem. C*, **121(34)**, 18575-185832017, <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.7b04511>
- [7] Rao X., Si Q., Shi T., Han X., and Ma, S., "Fe-doped C₃N monolayer as a promising SAC for CO oxidation with low temperature and high reactivity", *Computational and Theoretical Chemistry*, **1194**, 113080, 2021, <https://doi.org/10.1016/j.comptc.2020.113080>
- [8] Bagheri M., "Electrical and mechanical properties of a fully hydrogenated two-dimensional polyaniline sheet", *Computational Materials Science*, **153**, 126-133, 2018, <https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2018.06.027>
- [9] Bagheri M., and Izadi S., "Polyaniline (C₃N) nanoribbons: Magnetic metal, Semiconductor, and Half-Metal", *Applied physics* **124**, 84304, 2018, <https://doi.org/10.1063/1.5042207>
- [10] Xu J., Mahmood J., Dou Y., Dou S., Li F., Dai L., and Baek, J.B., "2D frameworks of C₂N and C₃N as new anode materials for lithium-ion batteries", *Advanced Materials*, **29(34)**, 1702007, 2017, <https://doi.org/10.1002/adma.201702007>
- [11] He B., Shen J., Ma D., Lu Z., and Yang Z., "Boron-Doped C₃N Monolayer as a Promising Metal-Free Oxygen Reduction Reaction Catalyst: A Theoretical Insight", *J. Phys. Chem. C*, **122**, 20312-20322, 2018, <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b05171>.
- [12] Wu, Q., Wongwiriyapan W., Park J.H., Sangwoo Park, Jung S.J., Jeong T., Lee S., Young H.L., and Song Y.J., "In situ chemical vapor deposition of graphene and hexagonal boron nitride heterostructures", *Current Applied Physics* **16(9)**, 1175-1191, 2016, <https://doi.org/10.1016/j.cap.2016.04.024>



- [13] Tedstone A.A., Lewis D.J., Hao R., Mao S.M., Bellon P., Averback R.S., et al, "Mechanical Properties of Molybdenum Disulfide and the Effect of Doping: An inSitu TEM Study", *ACS Appl. Mater. Interfaces*, **7**, 37, 20829–20834, 2015, <https://doi.org//10.1021/acsami.5b06055>
- [14] EinalipourEshkalak K., Sadeghzadeh S., and Molaei F., "Interfacial Thermal Resistance Mechanism for the Polyaniline (C3N)–Graphene Heterostructure", *J. Phys. Chem. C*, **124**, 14316–14326, 2020, <https://doi.org//10.1021/acs.jpcc.0c02051>
- [15]. Lau V.H., Mesch M.B., Duppel V., and Blum V., "Low-molecular-weight carbon nitrides for solar hydrogen evolution", *J. Am. Chem. Soc.*, **37**, 1064, 2015, <https://doi.org//10.1021/ja511802c>
- [16]. Geim A.K. and Grigorieva I.V., "Van der Waals heterostructures", *Nature*, **499**, 419–425, 2013, <https://doi.org//10.1038/nature12385>
- [17] Kademi Zahedi R., Shirazi A.H.N., Alimouri P., Alajani N., and Rabczuk T., "Mechanical properties of graphene-like BC₃; a moleculardynamics study", *Comput. Mater. Sci.*, **168**, 1–10, 2019, <https://doi.org//10.1016/j.commatsci.2019.05.053>
- [18] Sahafi M.H., "First-principles investigation of phonon spectrum, elastic, mechanical and thermophysical characteristics of an actinide-oxide ceramic", *J. Solid State Chem.*, **124102**, 2023. <https://doi.org//10.1016/j.jssc.2023.124102>
- [19] Cai Z., Liu B., Zou X. and Cheng H.M., "Chemical vapor deposition growth and applications of two-dimensional materials and their heterostructures", *Chemical reviews*, **118(13)**, 6091–6133, 2018, <https://doi.org//10.1021/acs.chemrev.7b00536>
- [20] Mendoza-Sánchez B., and Gogotsi Y., "Chemical vapor deposition growth and applications of two-dimensional materials and their heterostructures", *Chemical reviews*, **118(13)**, 6091–6133, 2018, <https://doi.org//10.1021/acs.chemrev.7b00536>
- [21] He B.L., Shen J.S., and Tian Z.X., "Iron-embedded C₂N monolayer: a promising low-cost and high-activity single-atom catalyst for CO oxidation", *Phys. Chem. Chem. Phys.*, **18 (35)**, 24261, 2016, <https://doi.org//10.1039/C6CP03398A>
- [22] Mahmood J., Lee E.K., Jung M., Shin D., Jeon I.Y., Jung S.M., Choi H.J., Seo J.M., Bae S.Y., Sohn S.D., Park N., Oh J.H., Shin H.J., and Baek J.B., "Nitrogenated holey two-dimensional structures", *Naturecommunications*, **6**, 6486, 2015, <https://doi.org//10.1038/ncomms7486>
- [23] Blaha P., Schwarz K., Madsen G.K.H., Kvasnicka D., Luitz J., Laskowski R., Tran F., and Marks L.D., "wien2k", *An augmented plane wave+ local orbitals program for calculating crystal properties*, **60(1)**, 2001.
- [24] Sahafi M.H., and Mahdavi M., "Ab initio investigations on lattice dynamics and thermal characteristics of ThO₂ using Debye–Einstein model", *Bull. Mater. Sci.*, **44**, 1–9, 2021. <https://doi.org//10.1007/s12034-021-02370-0>
- [25] Diakite Y.I., Traore S.D., Malozovsky Y., Khamala B., Franklin L., and Bagayoko D., "Accurate Electronic, Transport, and Bulk Properties of Gallium Arsenide (GaAs)", *arXiv preprint arXiv:1601.05300*, 2016, <https://doi.org//10.48550/arXiv.1601.05300>
- [26] Agrawal S., Kaushal G., and Srivastava A., "Electron transport in C₃N monolayer: DFT analysis of volatile organic compound sensing", *Chemical Physics Letters*, **762**, 138121, 2021, <https://doi.org//10.1016/j.cplett.2020.138121>
- [27] Esrafilo M.D., and Heydari S., "Si-doped C₃N monolayers as efficient single-atom catalysts for the reduction of N₂O: a computational study", *MolecularPhysics*, **18**, 118, 2020, <https://doi.org//10.1080/00268976.2020.1759830>
- [28] Molaei F., Eshkalak K.E., Sadeghzadeh S., and Siavoshi H., "Assessing mechanical properties of single-layer B-doped C₃N and N-doped BC₃ nanosheets and their hybrid", *Computational Materials Science*, **192**, 110368, 2021, <https://doi.org//10.1016/j.commatsci.2021.110368>



- [29] Bafeekry A., Stampfl C., Farjami Shayesteh S., "A First-Principles Study of C₃N Nanostructures: Control and Engineering of the Electronic and Magnetic Properties of Nanosheets, Tubes and Ribbons", *Chem. Phys. Chem.*, **21**, 164, 2020, <https://doi.org/10.1002/cphc.201900852>



This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

